

บทที่ 1

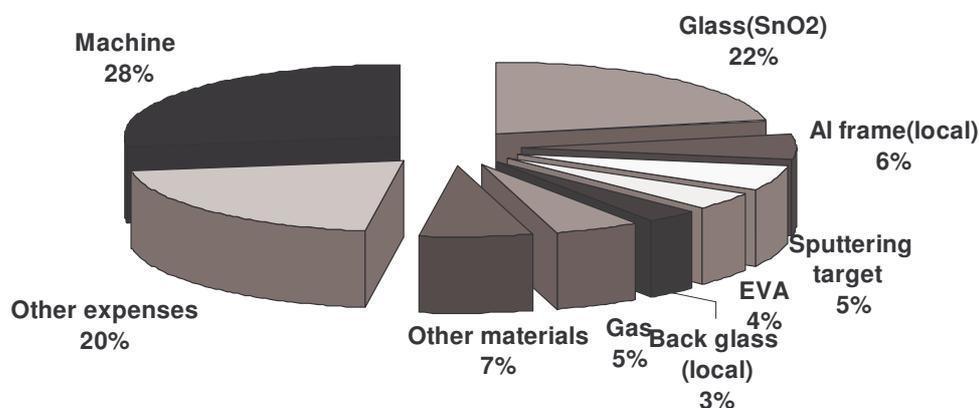
บทนำ

ในปัจจุบัน กระจกเคลือบขั้วโปร่งแสงนำไฟฟ้า หรือที่นิยมเรียกวัดสุประเภนี้ว่า Transparent conducting Oxides (TCO) เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีการนำไปใช้งานกันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน เนื่องจากคุณสมบัติเด่นคือ สามารถส่งผ่านแสงในช่วงที่ตามองเห็น (380-780 นาโนเมตร) และมีสภาพการต้านทานไฟฟ้าต่ำ ทำให้สามารถนำไฟฟ้าได้ จากคุณสมบัติเหล่านี้ทำให้กระจกเคลือบขั้วโปร่งแสงนำไฟฟ้าถูกนำไปใช้ทำ จอแสดงผล LCD (liquid crystal display) จอแบน (Flat panel displays) กระจกสะท้อนคลื่นความร้อน และเซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell)

ขั้วโปร่งแสงนำไฟฟ้า สามารถสร้างได้จากสารประกอบหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้กันมาก คือ อินเดียม ออกไซด์ (In_2O_3) ดีบุกออกไซด์ (SnO_2) ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ซึ่งอยู่ในรูปสารประกอบที่มีการเจือสาร (Doped) เข้าไปเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของสารนั้นๆ โดย อินเดียมออกไซด์ เจือด้วยดีบุก ($\text{In}_2\text{O}_3:\text{Sn}$) เรียกว่า ITO (Indium Tin Oxide) ดีบุกออกไซด์ เจือด้วยฟลูออรีน ($\text{SnO}_2:\text{F}$) เรียกว่า FTO และ ซิงค์ ออกไซด์ เจือด้วย โบรอน ($\text{ZnO}:\text{B}$)

1.1 ความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันกระจกเคลือบขั้วโปร่งแสงนำไฟฟ้า ที่นิยมนำมาใช้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน (amorphous silicon solar cell) นั้น มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ ITO มีราคาแพงเหมาะกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพมากกว่าการที่จะนำมาผลิตเป็นเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูง สำหรับ SnO_2 นั้นมีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าดีกว่า ZnO และปัจจุบันนิยมนำมาใช้ในการในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ ซึ่งกระจก SnO_2 นั้นคิดเป็นต้นทุนอยู่ที่ 22% แสดงดังภาพที่ 1.1 เมื่อพิจารณาถึงราคาของ SnO_2 แล้วมีราคาสูง เนื่องจากในปัจจุบันมีเพียงสองบริษัทในโลกที่ผลิตได้ คือ บริษัท Asahi float glass (AFG) และ Nippon sheet glass (NSG) วิธีการสร้างต้องใช้เทคนิคเฉพาะเรียกว่าวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส (spray pyrolysis) ซึ่งต้องใช้พลังงานสูง และเนื่องจากกระจกเคลือบ SnO_2 ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงคุณสมบัติทางแสงและทางไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเซลล์แสงอาทิตย์ได้ ส่วน ZnO นั้นมีเทคโนโลยีการสร้างไม่ยากมากนัก และสามารถทำให้พื้นผิวขรุขระเหมาะสมกับการใช้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชย์ได้



ภาพที่ 1.1

สัดส่วนต้นทุนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับโรงงาน 10MW
(ที่มา: สถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (Solartec))

เทคนิคในการเคลือบฟิล์ม ZnO สามารถทำได้หลายวิธี เช่น สเปตเตอริง (sputtering) วิธีสเปรย์ไพโรไลซิส (spray pyrolysis) วิธียิงลำโมเลกุล (molecular beam epitaxy:MBE) วิธี MOCVD (metal organic chemical vapor deposition) เป็นต้น สำหรับการพัฒนาวิธีการผลิตกระจกเคลือบขั้วโปร่งแสงนำไฟฟ้าในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนกระจกเคลือบ SnO₂ วิธีเคลือบฟิล์มบาง ZnO ด้วยวิธี MOCVD เป็นวิธีหนึ่งที่เหมาะสมเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตต่ำ ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก สามารถทำได้ที่อุณหภูมิต่ำประมาณ 100 °C - 200 °C และฟิล์ม ZnO ยังทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เป็น Hydrogen plasma ซึ่งใช้ในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางที่มีโครงสร้างเป็นอะมอร์ฟัสซิลิกอน ช่วยไม่ให้เกิดการแพร่ซึมของโลหะ Zn เข้าไปยังเซลล์แสงอาทิตย์ในระหว่างกระบวนการสร้าง ซึ่งจะทำให้เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพต่ำลง

สิ่งที่ทำให้เราสนใจอีกอย่าง คือ ความเป็น n-type หรือ พาหะที่ปฏิบัติตัวเป็นผู้ให้ ของสารประกอบ ZnO ที่ไม่เป็นสัดส่วนทางเคมีที่เกิดมาจาก Zinc interstitial และ Oxygen vacancies ซึ่งการเพิ่มของจำนวนพาหะใน ZnO สามารถทำได้โดยการให้ความร้อนกับออกซิเจน หรือด้วยการเจือสารเข้าไปในระดับที่เหมาะสม ในงานวิจัยนี้จะทำการเตรียมฟิล์มบาง ZnO ที่เจือด้วยอะตอมของโบรอน (B)

1.2 วัตถุประสงค์

- 1.2.1 เพื่อพัฒนากระบวนการเคลือบฟิล์ม ZnO บนกระจก ด้วยวิธี MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition)
- 1.2.2 เพื่อศึกษาเงื่อนไขของการเคลือบฟิล์ม ZnO ที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติทางไฟฟ้า คุณสมบัติทางแสง และโครงสร้างผลึกของฟิล์ม ZnO
- 1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อนำ ZnO:B ไปใช้เป็นขั้วโลหะโปร่งแสงนำไฟฟ้าแทนและ SnO₂:F

1.3 ขอบเขตงานวิจัย

- 1.3.1 ศึกษาคุณสมบัติของกระจกเคลือบฟิล์ม SnO₂:F
- 1.3.2 ทำการเคลือบฟิล์มบาง ZnO:B ด้วยวิธี MOCVD
- 1.3.3 ทดลองหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการนำไฟฟ้า การส่งผ่านแสง และโครงสร้างผลึกของฟิล์มบาง ZnO โดยตัวแปรที่ใช้ศึกษามีดังนี้
 - ก. ปริมาณสารเจือ B₂H₆
 - ข. อุณหภูมิในการเคลือบ
- 1.3.4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ขั้วไฟฟ้าโปร่งแสงระหว่าง กระจกเคลือบ ZnO:B กับ กระจกเคลือบ SnO₂:F

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 ได้เทคโนโลยีการสร้างกระจกเคลือบ ZnO:B เพื่อใช้เป็นขั้วโปร่งแสงนำไฟฟ้า ด้วยวิธี MOCVD ในการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน
- 1.4.2 ได้วัสดุที่ใช้เป็นขั้วโปร่งแสงนำไฟฟ้าเพื่อการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด ZnO:B ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับกระจกเคลือบขั้วโปร่งแสงนำไฟฟ้าชนิด SnO₂:F
- 1.4.3 สามารถนำข้อมูลทางด้านเทคนิคการเคลือบขั้วโปร่งแสงนำไฟฟ้าและผลการทดลองนำไปพัฒนาเครื่องจักรสำหรับการผลิตขั้วโปร่งแสงนำไฟฟ้าชนิด ZnO:B บนกระจกพื้นที่ขนาดใหญ่ เพื่อทดแทนการนำเข้ากระจก SnO₂:F จากต่างประเทศได้